自己ドープ型導電性材料の開発

箭	野	裕	*1
西	Щ	正	*1
林		定	快 ^{*1}

Water-Soluble Self-Doped Conducting Polymers

Hirokazu YANO Masakazu NISHIYAMA Sadayoshi HAYASHI

The newly developed self-doped conducting polymer (SELFTRON[®]; Tosoh Corporation) exhibited the highest level of conductivity among all reported self-doped conducting polymers (approx. 200 S/cm). This polymer is also water-soluble, and exhibits various other characteristics that differ from that of the widely used water dispersion-type conducting polymer, PEDOT:PSS.

1. はじめに

導電性高分子は、固体電解コンデンサの電解質や光 学フィルムなどの帯電防止剤、有機 EL や太陽電池の 正孔注入層、透明電極等に応用されている¹⁾。中でも ポリ(4-スチレンスルホン酸)をドープしたポリ(3,4 -エチレンジオキシチオフェン)(PEDOT:PSS)は最 も成功した導電性高分子の一つであり、約1000 S/cm と高い電気伝導度を示すことが知られている(Fig.1)。 一方で、PEDOT:PSSはコロイド粒子の水分散体であ るため、極薄膜層の形成やアルミ固体電解コンデンサ の高容量化に求められる細かいアルミエッチングピッ トへの含浸性においては課題もあり、依然として水溶 性と導電性を両立した材料の要求がある。

これまでに十分な水溶性を有する導電性高分子として、水溶性の付与とドーパントの役割を担うスルホン酸基をポリマー骨格中に有する自己ドープ型の導電性高分子が報告されている²⁻⁷⁾ (Fig.2)。しかしながら、未だ導電性が数十 S/cm と低いため、その用途は極め

て限定的であり、更なる電気伝導度の向上が求められ ていた。

今回我々は、先行文献の中から比較的高い導電率 を示す SDP-5のような自己ドープ型 PEDOT に着目 した。具体的には、3,4-エチレンジオキシチオフェン (EDOT)のエチレンジオキシ環にスペーサーを介し てスルホネート基を有する SDP-5の構造異性体モノ マーを合成し、種々重合条件を検討した結果、これま でに報告されている自己ドープ型導電性高分子の中で 最も高い導電性を示す材料を見出すに至った。本稿で は、新規な自己ドープ型導電性材料 SELFTRON[®]の合 成とその物性について報告する(Fig.1)。



Fig. 1 PEDOT: PSS and SELFTRON®



Fig. 2 Self-doped conducting polymers (SDP)

2. 実 験

[1] 分析方法・装置

(1) モノマー合成

反応の追跡及び純度分析は、ガスクロマトグラ フィー分析 (GC)、又は液体クロマトグラフィー分析 (LC) で行った。GC は島津製作所社製の SHIMADZU GC-2025 (カラム: InertCap5) を使用し、LC は東 ソー社製カラム TSK-GEL ODS-120T、溶離液に 50 mM リン酸緩衝液 [(pH = 2.8、Na₂H₂PO₄-H₃PO₄)/ CH₃CN = 1/1] を用いて行った。モノマーの同定に は、BRUKER 社製 NMR (ADVANCE III HD500) [¹H - NMR (500 MHz)、¹³C - NMR (125.8 MHz)、D₂O 溶媒/TSP 標準] と、IR (PERKIN ELMER 社製 System 2000 FT-IR) (KBr) を用いた。

(2) ポリマー合成

重合時のモノマー転化率は、重合液をウルトラフィ ルターユニット(アドバンテック社製USY-1/分画分 子量10K)でろ過した液中の残存モノマーをLC(内 部標準法)で分析して算出した。また、ポリマーの 分子量は、東ソー社製カラムTSKgel α -Mと guard column α 、溶離液にDMSO/10 mM-LiBr、標準試 料にPullulanを使用したゲル浸透クロマトグラフィー 分析(GPC)で行った[流量:0.6 mL/min、検出:UV(335 nm)、温度:50℃、注入量:20 μ L(1000 ppm)]。ポ リマー水溶液中の固形分濃度は、加熱乾燥式水分計 (エー・アンド・デイ社製MS-70)を用い、150℃で の恒量値から算出した。

[2] 導電性ポリマーの物性評価

(1) 導電性

予め UV/O₃処理(セン特殊光源社製表面処理装置 PL16-110)した3 cm 角のガラス基板(Coaning 社 製 EagleXG)に、1 重量%の導電性ポリマー水溶液を キャストし、グローブボックス中で室温にて一晩乾燥 した後、ホットプレート(アズワン社 DIGITAL HOT PLATE HP-2SA) 上で 150°C、30 分間ベークした (窒 素雰囲気中)。得られた塗膜の表面抵抗率 (Ω/\Box) を 三菱化学社製ロレスタ MCP-T600 (四探針法) で測 定した後、カッター等で塗膜に段差を設け、BRUKER 社製 DektakXT で導電膜の厚みを測定した。引き続き、 次式に従って導電率 (S/cm)を算出した。 (式) 導電率(S/cm)=1/[表面抵抗率(Ω/\Box)×導電

(2) 比較材料

膜の厚み(cm)]

リファンレンスには PEDOT: PSS を用いた。

3. 結果と考察

[1] モノマー合成

(1) 設計

水分散体の PEDOT: PSS は、疎水性の PEDOT に 対して、親水性の PSS がドーパント兼水分散剤とし て上手く機能した優れた導電性高分子である。一方で、 絶縁性の PSS は導電膜の電気伝導度を低下させる一 因となるため、我々は PSS を使用せずに、ドーパン トと水溶性付与の役割を担うスルホン酸基を PEDOT にスペーサーを介して導入することで、水溶性と導電 性を両立した材料の開発を指向した。

特に PEDOT 骨格は、エチレンジオキシ環の電子供 与性効果によりチオフェンよりも酸化重合しやすいこ と、さらにチオフェンの3、4位が置換基でブロック されているため、2、5位で選択的に重合が進行し不 純物が少ない、安定性に優れるなどの多くの利点を有 していることから、この PEDOT をベースとした自己 ドープ型導電性高分子の開発に着手した。

既知のヒドロキシメチル EDOT (= HMEDOT)か ら誘導可能なモノマーの内、合成上安全性の高いスル トンを使用できる新規な SEDOT モノマーを考案し、 それから合成できる導電性ポリマー (SELFTRON[®]) をターゲットとして検討を開始した (Scheme 1、 Table 1)。

Scheme 1 Target monomer and polymer



 Table 1
 Toxicity (LD50) of Sultones^{8, 9)}



(2) SEDOT モノマーの合成 (Scheme 2)

市販の3,4-ジヒドロキシチオフェン-2,5-ジカルボ ン酸ジエチルエステル1を出発原料に用い、2,3-ジブ ロモプロパンジオールとのエーテル交換反応を、炭酸 カリウム存在下、DMF/DMSO 溶媒中、100℃で12 時間行うことでエチレンジオキシ環を有する中間体 2 を合成した。

引き続き、得られた中間体2をEtOHに溶解し、 NaOH水溶液を加えて還流温度で2時間、エステル 加水分解反応を行った。さらに酸処理を経て中間体3 を茶褐色粉末として出発原料1から収率80%(純度 99.8LC%)で得た。

さらに、中間体3の脱炭酸反応を DMF 中、CuO 存

在下、130℃で4時間行った後、シリカゲルカラムク ロマトグラフィーで精製して白色固体の HMEDOT を 収率 60%で得た(純度 99.9GC%)。

次に、NaHを懸濁した THF 溶媒に HMEDOT を添加し還流温度で1時間活性化した。その後、2,4-ブ タンスルトンを滴下し、2時間スルホン化反応を行っ た。反応後、EtOH でクエンチし、THF を減圧留去し た。得られた溶液にアセトンを加え、トルエン溶媒 中に添加し晶析させることで、淡黄色固体の SEDOT モノマーを収率 75%(総合収率 42%)で得た(純度 99.2LC%)。Fig.3~5に SEDOT の NMR、IR スペク トルを示す。



Scheme 2 Synthesis of SEDOT monomer



Fig. 5 FT-IR (SEDOT)

[2] ポリマー合成

(1) 重合条件検討

SEDOT モノマーの重合は、先行文献 [10] を参考に、 酸化剤に Fe 塩と過硫酸塩を併用した化学酸化重合で 行った。SEDOT モノマーの水溶液に Fe 塩を溶解さ せた後、所定温度で過硫酸塩の水溶液を滴下し重合を 行った。得られた濃青色の重合液をイオン交換等で精 製した後、ガラス基板に成膜して SELFTRON[®]の導電 率を測定した。

酸化剤(Fe 塩)(Scheme 3)

まずは Fe 塩として 3 価の FeCl₃ を用いて仕込み量 を検討した結果、SEDOT モノマーに対して 0.1 eq. で は 8 S/cm と低く、0.6 eq. の場合に 208 S/cm とこ れまで報告されている自己ドープ型導電性高分子を 上回る高い値を示した。一方で、FeCl₃ 量を 0.8、5.0 eq. と増加しても著しい導電性の向上は見られなかっ た (Fig.6)。

次に、仕込み量を 0.6 eq. に固定して Fe 塩の種類を 検討した。2 価の FeCl₂、3 価の Fe(NO₃)₃・9H₂O、 Fe₂ (SO₄)₃、Fe(CF₃SO₃)₃を比較検討したが、FeCl₃ が 最も良好な結果を示した(Fig.7)。尚、Fe 塩を添加 せずに Na₂S₂O₈のみを用いて重合した場合には 0.001 S/cm と非常に低いものであった。本結果を受けて、 FeCl₃/SEDOT = 0.6 eq を最適条件とした。重合機構 としては、Fe 塩存在下、過硫酸塩を添加してから急 激に系が濃青色に発熱をともなって変化することか ら、基本的には Fe(II) と過硫酸塩からなるレドッ クス系と考えられる。Fe(III) を使用した場合には、 Fe(III) が SEDOT を酸化して Fe(III) となった後、 過硫酸イオンと反応して生成した SO₄ \bullet -で SEDOT の 重合が効率よく進行したと考えられる。



酸化剤(過硫酸塩)(Scheme 4)

Na₂S₂O₈の仕込み量を SEDOT モノマーに対して 0.6 ~ 6.0 eq. の範囲で検討した(Fig.8)。その結果、1.1 eq. までは 34 S/cm と低導電率であったが、1.8 ~ 2.2 eq. で約 200 S/cm を示すことがわかった。但し、6.0 eq. に増加しても導電率に大幅な向上はなかった。本 結果を受けて、Na₂S₂O₈/SEDOT = 2.0 eq を最適条件 とした。



Fig. 8 Effect of Na₂S₂O₈/SEDOT [mol.r.]

重合温度、重合時間 (Scheme 5)

FeCl₃/Na₂S₂O₈/SEDOT = 0.6/2.0/1.0 [mol.r.]、3.6重量% SEDOT条件で重合温度と重合時間を検討した。 まずは重合時間を 3 時間に固定して重合温度を 1 Cか ら 35 Cの範囲で検討した結果、 $10 \sim 35$ Cで得られた ポリマーの導電率に大きな違いはなかったが、低温の 1 Cでは導電率は低下した。重合速度の低下が原因と 推定される。

次に、重合温度 20℃で重合時間(過硫酸塩水溶液 を滴下後)の影響を調べた結果、3 時間で SEDOT モ ノマー転化率は 98.5%であり、導電率の面からも十分 重合が進行していることがわかった(Fig.9 ~ 11)。

重合時の SEDOT モノマー濃度 (Scheme 6)

SEDOT モノマー濃度をベース条件の 3.6 重量%から 2.4 重量%に下げた場合には導電性が低下したが、

9.8、12.9 重量%と高めることで208 S/cmから370 S /cmに向上し、導電率は仕込みモノマー濃度と相関が 見られた(Fig.12)。溶液重合ではモノマー濃度の増 加とともに分子量が増加することから、SELFTRON[®] においても同様に高分子量化が進行し、導電率の向 上に寄与している可能性がある。一方、操作的には SEDOT 濃度が10%以上では重合液が高粘度化して通 常撹拌では困難であったため、現在、強撹拌可能な装 置を用いて再検討中である。

また、3.6 重量%モノマー濃度を標準条件として 再現性を検討した結果、Fig.13 に示すように、導電 率 196、208、223 S/cmと安定した導電性を有する SELFTRON[®]が再現よく得られた(重合収率 75%)。



(2) 分子量測定(GPC)

SELFTRON[®]の類縁体である PEDOT-S (Fig.1 の SDP-5)の導電率は 30 S/cm であり、その重量平均 分子量 Mw は 5500 g/mol と報告されている⁷⁾。今回 合成した SELFTRON[®] は導電率が 200 S/cm 程度と大 きく向上していることから、高分子量化している可能 性を考え、GPC で確認を試みた。

はじめに SELFTRON[®] 水溶液を直接 GPC で分析



Fig.14 GPC spectrum

した結果、GPC カラムへの吸着が大きく測定困難と なった。そこで、適当なアミン(例えば、N,N-ジイ ソプロピルアミンなど)で中和した後、濃縮乾固し DMSO 溶媒系に置換することでカラムへの吸着を抑 えることが可能となり、Fig.14 に示すような GPC ス ペクトル(微分分子量分布曲線)が得られた。本測 定結果より、SELFTRON[®]の重量平均分子量 Mw は 22000 g/mol (Pullulan 換算)と従来報告よりも高い 値を示し、高分子量化していることが示唆された。



Fig.12 Effect of SEDOT concentration

- [3] 物性評価
- (1) SELFTRON[®] 水溶液

水溶性

水 溶 性 は 0.5 重 量 % の SELFTRON[®] 水 溶 液 と PEDOT: PSS 水溶液を作製し、 0.02μ m フィルター (Entegris 社 製 の Optimizer V-U47 0.02 μ m PCM UPE) への通液性で判断した。その結果、分散体の PEDOT: PSS では溶媒の水のみが通液し、ポリマー はフィルター上に残った。一方で SELFTRON[®] 水溶液 は通液したため、水溶性に優れた可溶性タイプと判断 した (Fig.15)。

UV-Vis-NIR

100 ppm 濃度の SELFTRON[®] 水溶液を紫外可視赤外 分光光度計(島津製作所製 UV-3100)で測定して得 られた UV-Vis-NIR スペクトルを Fig.16 に示す。ドー ピングにより生じたポーラロン、バイポーラロン状態 に対応する可視光から近赤外にかけての吸収が観測さ れ、外部からドーパントを添加することなくドーピン グが進行している(自己ドープ型)ことが確認された。



Fig.15 Filtration test

粘度

SELFTRON[®] 水溶液中の SELFTRON[®] 濃度(重量%) と粘度(mPa·s/20℃)の関係を Fig.17 に示す。尚、 粘度の測定は BROOKFIELD 社製 VISCOMETER DV-1 Prime を使用した。SELFTRON[®] 濃度と粘度には相 関があり、ポリマー濃度で粘度調整が可能である。

不純物

2 重量% SELFTRON[®]水溶液中に含まれる Na、Fe 含有量を ICP-AES (高周波誘導結合プラズマ発光分



Fig.16 UV-Vis-NIR spectrum of SELFTRON®



Fig.17 Viscosity of SELFTRON® aqueous solution

析法)で測定した結果、各々 0.76 ppm、0.87 ppm であった。また、イオンクロマト分析から SO₄²⁻は 16 ppm で あった。

pH 安定性

2 重量% SELFTRON[®] (pH1.7) を N,N-ジメチルエ タノールアミンで各 pH に調整した後、各々ガラス上 に成膜して導電率を測定した結果を Fig.18 に示す。尚、 pH は HORIBA 社製 pH メーター LAQUAact D-71 を 用いた。pH を酸性から中性~弱アルカリ性に調整し た場合、導電率は初期値から約 1/2 程度に低下した が 100 S/cm レベルを維持した。また、pH 調整時に ゲル化等の問題も見られなかった。

(2) 膜物性

透明性、平滑性

塗膜は 0.75 重量% SELFTRON[®] 水溶液(9% EtOH を含む)を UV/O₃処理した 3 cm 角のガラス基板に ミカサ社製 OpticoatMS-A150を用いてスピンコート して作製した(1200 rpm × 80 秒→100℃×1分ベー ク)。得られた塗膜の透明性をヘーズメーター(日本 電色社製 NDH4000)で測定した結果、透過率 97.6%、 ヘーズ 0.07%(何れも基材ブランク)であった。さら に Fig.19 に、紫外可視赤外分光光度計(島津製作所



Fig.18 Effect of pH on Conductivity

製 UV-3100)を用いて測定した結果を示す。可視光 領域に特異な吸収も無く良好な透明性を示した(膜厚 23 nm)。

また、平滑性はAFM(日立ハイテクサイエンス社 製 E-sweep)で表面粗さを測定した結果、Ra は 0.53 nm(5 μ m 視野)と平滑な塗膜を作製できることが わかった。

耐熱性

導電性ポリマーでコーティングした(膜厚:約5µm)ガラス基板を ETTAS 社製 EOP-450B中、大気中 125℃で 300 時間処理し、表面抵抗率 SR の初期値 SR₀ からの変化を調べた結果を **Fig.21** に示す。300 時間後 の変化倍率は SELFTRON[®]が 3.2 倍、PEDOT: PSS は 3.4



Fig.19 Transparency of spin-coated film



Fig.20 AFM image of spin-coated film

倍と両者に大きな差は見られなかったため、耐熱性は 同程度と推定した。

耐湿性

導電性ポリマーでコーティングした(膜厚:約5 μ m) ガラス基板をエスペック社製SH-222中、60°C95% RHで300時間処理し、表面抵抗率SRの初期値SR₀ からの変化を調べた結果をFig.22に示す。PEDOT: PSSは50時間後に大きく表面抵抗率が変化した。親 水性のPSSが存在するため吸湿して膜厚が増加した ことで、表面抵抗率の低下(変化)が見られたと考え られる。一方でPSSのような親水性の高分子ドーパ ントを含まないSELFTRON[®]は耐湿試験後も表面抵抗 率に大きな変化は見られず安定していた。本結果から、 SELFTRON[®]はPEDOT:PSSよりも耐湿性に優れる 可能性が示唆された。

耐光性

導電性ポリマーでコーティングした(膜厚:約5µ m)ガラス基板を紫外線フェードメーター(スガ試験 機社製U-48/カーボンアーク、光源波長388 nm、ブ ラックパネル温度60℃)中で192時間処理し、表面



Fig.22 Humidity resistance



Fig.23 UV resistance

抵抗率 SR の初期値 SR₀からの変化を調べた結果を Fig.23 に示す。PEDOT: PSS(2.6倍)と比較して、 SELFTRON[®]の処理後の表面抵抗率の変化(1.4倍) は小さく、耐光性に優れる可能性が示唆された。

4. まとめ

高い導電性を有する新規な自己ドープ型導電性材料 SELFTRON[®]を開発し¹¹⁾、そのポリマー物性を調べた。 SELFTRON[®]が200 S/cmを超えるまでに高導電化し た要因は、スペーサー構造と重合条件最適化による高 分子量化によるものと考えられる。高分子量化により ポリマー鎖間の相互作用が高まることで塗膜の配向性 が向上し、その結果、分子鎖間の電子移動が改善し導 電性が向上したと推定している。

また SELFTRON[®] は汎用の水分散体 PEDOT: PSS とは異なる水可溶性や高耐久性の特徴を示した。溶解 型の SELFTRON[®] は、コンデンサの固体電解質形成に おいて課題となる細かい Al エッチングピット、Ta 焼 結体への含浸性に優れる可能性があり、更なる高性能 化(高容量化)が期待される。また、耐久性に関しては、 特に耐湿性、耐光性に優れているため、デバイスに搭 載可能な導電膜や帯電防止膜への応用も期待される。

当社では、SELFTRON[®] をベースに各種用途に応じ たコーティング液の開発と、更なる用途拡大のため SELFTRON[®]の高導電化に関する技術開発も鋭意検討 中である。

5. 謝辞

本研究を進めるにあたり終始適切な指導をしてい ただきました山梨大学の奥崎秀典教授に感謝いたしま す。

6. 文 献

- H. Okuzaki ed., "PEDOT: Material Properties and Device Applications", Science & Technology (2012)
- [2] X. L. Wei, Y. Z. Wang, S. M. Long, C. Bobeczko, A. J. Epstein, J. Am. Chem. Soc., 118, 2545 (1996) .
- [3] A. O. Patri, Y. Ikenoue, F. Wudl, A. J. Heeger, J. Am. Chem. Soc., 109, 1858 (1987) .
- [4] Y. Ikenoue, Y. Saida, M. Kira, H. Tomozawa,H. Yashima, M. Kobayashi, Chemical Communications, 1694 (1990)
- [5] K. Faid, M. Leclerc, Chemical Communications, 2761 (1996)
- [6] G. Zotti, S. Zecchin, G. Schiavon, L. B. Groenendaal, Macromol. Chem. Phys., 203, 13, 1958 (2002)
- [7] K. M. Perrson, R. Karlsson, K. Svennersten, S. Löffler, E. W. H. Jager, A. Richter Dahlfors, P. Konradsson, M. Berrgren, Adv. Mater., 23, 38, 4403 (2011)
- [8] 東京化成工業株式会社 SDS
- [9] 和光純薬工業株式会社 SDS
- [10] R. H. Karlsson, A. Herland, M. Hamedi, J. A. Wigenius, A. Åslund, X. Liu, M. Fahlman, O. Inganäs, P. Konradsson, Chem. Mater., 21, 1815 (2009)
- [11] 国際公開特許 W02014/007299 (東ソー株式会社)